Accounts of Materials & Surface Research

Lamellar/Onion Transition in Nonionic Surfactant Systems

Tadashi Kato

Tokyo Metropolitan University 1-1 Minami-Osawa, Hachioji, Tokyo 192-0397 kato-tadashi@tmu.ac.jp

In the past two or three decades, many studies have been reported concerning effects of shear flow on the structure of the lyotropic phase. Among them, the most striking result may be the transition from the lamellar phase to the "onion phase" where all the space is filled by multilamellar vesicles alone, which cannot be observed at rest in usual. After the first publication by the French group in 1993, the onion formation has been reported for many surfactant systems. However, conditions and mechanism of the transition have not yet been fully understood.

About 8 years ago, we have found the lamellar-to-onion transition with *increasing* temperature under a constant shear rate in a nonionic surfactant ($C_{16}E_7$ /water, C_nE_m is an abbreviation of $C_nH_{2n+1}(OC_2H_4)_mOH$) system by using simultaneous measurements of rheology/small- angle light scattering (rheo-SALS) and rheology/small- angle X-ray scattering (rheo-SAXS). Recently, we have also found a system ($C_{14}E_5$ /water) which exhibits re-entrant transition, i.e., the lamellar-onion-lamellar transition with varying temperature. It is shown that the onion phase forms a closed loop in a temperature-concentration diagram at a constant shear rate.

Comparison of the dynamic phase diagrams of homologous systems suggests that the re-entrant transition should be a rather general phenomenon although either the upper or lower transition can be observed in the most systems. Theoretical discussion reveals that the re-entrant transition with temperature variation may be dominated by temperature dependence of the deformation energy of planar lamellae at rest.

From detailed measurements of rheo-SAXS near the transition temperatures both for heating and cooling processes, it has been suggested that the lamellar/onion intermediate structures exist not as transient but as steady states determined by the temperature and the shear rate.



Keyword: surfactants, lamellar phase, rheology, small-angle X-ray scattering, small-angle light scattering

Tadashi Kato received his D. Sci. degree from Tokyo Metropolitan University in 1980. He was an Assistant Professor at Institute for Molecular Science (1980-1984) and Tokyo Metropolitan University (TMU)(1984-1987), respectively. Then he became an Associate Professor at TMU from 1987 to 1997. In 1990, he was a Visiting Fellow at Washington University in St. Luis. Currently he is a Professor at TMU (since 1998).



非イオン界面活性剤ラメラ相のずり流動場効果

加藤 直 *首都大大学東京*

1. はじめに

一般にソフトマターはその構成単位が 低分子の大きさに比べて大きく,そのため 低分子の分子運動に比べてはるかに遅い運 動モードを有する。したがって,10⁻³~10³ s 程度の遅い時間スケールで変化する外場に よってその平均構造が影響を受けることが 多い。ずり流動場はこのような外場の一つ であるが,試料の調整,料理,流動性があ る製品の製造工程等で行われる攪拌・振と う操作,化粧品・軟膏・塗料の塗布操作等 の身近な操作で生じるため,その効果に関 する研究は,実用的にも重要である。

界面活性剤や脂質などの両親媒性分子 が作るリオトロピック相は、ソフトマター に共通した特徴に加えて,構成単位自体が 分子集合体であり,かつ長距離秩序を有す るという特徴を持つため、ずり流動場によ りしばしば劇的な相転移や構造転移を起こ す。中でも界面活性剤ラメラ相が、ずり流 動場により「オニオン相」に転移する現象 は、25年前にフランスのグループ¹⁾によっ て見出されて以来,多くの研究者の注目を 集めている²⁾³⁾。リン脂質等が作る過剰水中 に分散した多重膜ベシクルも、しばしば「オ ニオン」と呼ばれるが、ここで言う「オニ オン相」は、空間が多重膜ベシクルのみで 充填されており,水は膜間のみに存在する。 そのため個々の多重膜ベシクルは球形では なく,多面体と考えられている(Figure 1)。 現在までに種々の界面活性剤系でオニオン 相の形成が報告されており,また薬物輸送 システムや化学反応への応用も試みられて

Acc. Mater. Surf. Res. 2019, Vol.4 (No.2), 39-49.

いる。しかし、例えばずり速度等を変数の 一つとする「動的相図」が報告されている 系は非常に少ないため、オニオン相が形成 される条件について、統一的な理解が進ん でいない³⁾。またラメラ相からオニオン相 への転移機構についても諸説があり、さら に逆の転移、すなわちオニオン相からラメ ラ相への転移機構はほとんどわかっていな い³⁾。





ポリオキシエチレン系の非イオン界面 活性剤 $C_nH_{2n+1}(OC_2H_4)_mOH(C_nE_m)$ と水の2成 分系は、静止状態において、温度変化のみ により種々の相に転移することが知られて いる。これはオキシエチレン基の conformation が温度に大きく依存し、集合 体表面の自発曲率を変化させるためと考え られている。したがって、 C_nE_m 系における 温度は、イオン性界面活性剤系の塩濃度と 同等な役割を果たす重要な変数となる。添 加物濃度を連続的に変化させることは困難 であるが、温度を連続的に変化させることと は容易であり、また静電相互作用を考慮す る必要がないため、 C_nE_m 系は転移の条件や 機構を調べる上で有用な系であると言える。 このことはずり流動場下の転移に対しても 当てはまる。ここでは我々が初めて見出し た温度上昇に伴うラメラ→オニオン転移 ⁴⁾⁵⁾および温度変化に伴うリエントラント 転移(ラメラ→オニオン→ラメラ転移)⁶⁾ を中心として、オニオン相の形成条件と転 移機構について述べる。

2. 二分子膜の形態と単分子膜の自発曲率

オニオン相はずり流動場によってのみ形 成されるが,後で述べる我々の研究結果に よると,静止状態(ずりを印可しない状態) の物性,特に二分子膜の弾性的性質が,流 動場下におけるオニオン相の形成条件に大 きく影響するので,まず静止状態における 二分子膜の形態と単分子膜の自発曲率の関 係について簡単にまとめておく。

ずり流動場がない状態(静止状態)におけ る孤立膜の安定性は、しばしば膜の弾性率 を用いて議論される。平坦な膜のエネルギ ーを基準とした場合、曲率半径 R と & で規 定される曲面を持つ二分子膜の単位面積当 たりの弾性エネルギーは次式で与えられる ⁷¹⁸。

$$F = \frac{1}{2}\kappa \left(\frac{1}{R_{1}} + \frac{1}{R_{2}}\right)^{2} + \bar{\kappa}\frac{1}{R_{1}R_{2}}$$
(1)

ここで κ は曲げ弾性率、 $\bar{\kappa}$ はサドル・スプ レイ弾性率である。 $R_1 \ge R_2$ は正負の符号を 含み、馬の鞍のように曲率半径の中心が面 に対して互いに反対側にあるときは、どち らか一方の曲率半径の符号を負にとる。半 径Rのベシクルの場合は $R_1 = R_2 = R$ である から、単位面積当たりの弾性エネルギーは 式(1)から

$$F_{Va}(R) = (2\kappa + \bar{\kappa})\frac{1}{R^2}$$
(2)

となる。式(2)にベシクルの表面積 $4\pi R^{2} \epsilon$ 掛けると、ベシクル 1 個当たりの弾性エネ ルギー $F_{V} = 4\pi(2\kappa + \bar{\kappa})$ となり、ベシクルの 大きさに依存しない。この式は、 $\bar{\kappa} < -2\kappa$ の 場合に $F_{\nu} < 0$ 、すなわちベシクルが平坦膜 より安定になることを示している。一方、 $\bar{\kappa} > 0$ の場合はスポンジ相 (L₃相) がより安 定となる。言い換えれば、ベシクル、平坦 膜、スポンジ相の安定条件は、それぞれ $\bar{\kappa}/\kappa < -2, -2 < \bar{\kappa}/\kappa < 0, \bar{\kappa}/\kappa > 0$ 、となる。

二分子膜の弾性率 $\kappa \ge \bar{\kappa}$ は、二分子膜を 構成する単分子膜の曲げ弾性率 κ_m とサドル スプレイ弾性率 $\bar{\kappa}_m$ を用いて次式のように 表される^{8),9)}。</sup>

$$\kappa = 2\kappa_m \tag{3}$$

 $\bar{\kappa} = 2(\bar{\kappa}_{\rm m} - \kappa_{\rm m} H_{0m} \delta) \tag{4}$

ただし δ は二分子膜の厚さ, H_m は単分子膜 の自発曲率である。自発曲率は、与えられ た条件下で弾性エネルギーが極小になる曲 率で、そのときの曲率半径を R_a とすれば H_m = 1/R である。式(3)(4)を用いると,先に スポンジ,平坦膜,ベシクルの安定条件は, それぞれ次の(5a)~(5c)式となる。

$$H_{0m}\delta < \frac{\kappa_{\rm m}}{\kappa_{\rm m}} \tag{5a}$$

$$\frac{\overline{\kappa}_{m}}{\kappa_{m}} < H_{0m}\delta < 2 + \frac{\overline{\kappa}_{m}}{\kappa_{m}}$$
(5b)

$$2 + \frac{\overline{\kappa}_{\rm m}}{\kappa_{\rm m}} < H_{0m}\delta \tag{5c}$$

一方, $\kappa_m \geq \bar{\kappa}_m$ が取り得る値の範囲は, それ ぞれの定義から $-2 < \bar{\kappa}_m / \kappa_m < 0 \geq x$ る。こ れらの条件に,二分子膜自体の安定条件 $-1 < H_{0m} \delta < 1$ がさらに加わる。したがって, ベシクルが安定になるためには,式(5a)に 加えてこれらの条件が満たされなければな らず,そのような $B_m \geq \delta$ の値の範囲は極め て狭い。静止状態において安定なベシクル 相が存在することが稀なのは,このためで ある。

オニオン相を形成するベシクルは,一枚 膜ではなく多重膜であり,また形状も球で はなく多面体であるが,これらを考慮した 表現については後で述べる。

3. ずり流動場下の温度上昇に伴うラメラ→ オニオン転移⁴⁵⁵

我々が研究を開始する前に CnEm 系で動的 相図が報告されていたのは, Oliviero ら¹⁰⁾ が作成した C10E3/水系のみであった。一般 に、ラメラとオニオンのどちらの相も、粘 度がずり速度上昇と共に減少する shear-thinning を示すが、 ラメラからオニ オンに転移するずり速度範囲ではずり速度 上昇と共に粘度が上昇する shear-thickening を示すことが知られて いる。この shear-thickening 領域はラメラ とオニオンの「中間領域」とされている。 0liviero らは, 温度3点で測定した粘度の ずり速度依存性に基づいて,温度-ずり速度 相図を作成した。ただし高ずり速度領域(10 s⁻¹と100 s⁻¹)では、ずり速度一定下で温度 を変化させて行った SANS 測定の結果 ¹¹⁾も 考慮して境界線を引いている。この温度-ずり速度相図は,一定ずり速度下で温度を 下降させると、 ラメラ→オニオン転移が起 こることを示している。

これに対して我々は、ずり応力/小角光散 乱同時測定 (rheo-SALS) およびずり応力/X 線小角散乱同時測定 (rheo-SAXS)を用いて、 一定ずり速度下の温度上昇に伴いラメラ→ オニオン転移が起こることを、 $C_{16}E_7/$ 水系に おいて初めて見出した。Figure 2 に $C_{16}E_7$ (48 wt%) /水系ラメラ相における rheo-SAXS 測定の結果を示す。

図の上部に示したように,流動場中のラ メラ膜の積層方向は、流動(flow)方向、 速度勾配(velocity gradient)方向、お よびこれら2つの方向に垂直な neutral 方向の3つの成分に分けられる。セルの中 心を通過する radial beam により、neutral 方向と流動方向に積層した膜の回折ピーク が 観 測 でき、 セルの端を通過する tangential beam により、neutral 方向と 速度勾配 方向に積層した膜の回折ピーク が観測できる。流動場中で配向したラメラ 相の場合、一般に radial beam を用いて得 られる 2 次元散乱パターンには neutral 方 向に強い回折ピークが現れ、flow 方向の強 度は弱い。これは flow 方向に積層したラメ ラ膜は流動を遮るため、他の配向に変化し やすいためである。tangential beam を用 いた場合は、速度勾配方向と neutral 方向 に強い回折ピークが現れ、大小関係は条件 に依存する。一方オニオン相の場合、ラメ ラ膜はすべての方向に均等に配向するため、 radial beam、tangential beam 共に、リン グ状の回折ピークが観測される。



Figure 2. Temperature dependence of the viscosity (c) and 2-D SAXS patterns observed simultaneously for the radial (a) and tangential (b) configurations for C₁₆E₇ (48 wt%) /water system⁵⁾.

Figure 2 はずり速度を 3 s⁻¹に固定して 温度を上昇させたときの結果で, (a) (b)は, それぞれ radial beam と tangential beam から得られた 2 次元 SAXS パターン, (c)は ずり応力の温度依存性を示している。67℃ 以下の SAXS パターンは, ラメラ膜が速度勾 配方向と neutral 方向に配向していること を示しており, ずり応力の温度依存性は小 さい。67℃を超えると, 温度上昇と共にず り応力が大きく増大し, 同時に SAXS パター ンが変化する。70℃を超えるとずり応力の 上昇は緩やかになり, SAXS パターンはリン グ状となる。



Figure 3. Temperature-shear rate diagram for $C_{16}E_7$ (48 wt%) /water system (a) and 2-D SALS patterns (b). The panel (c) shows calculated patterns for optically-anisotropic spheres^{4,5)}.

これらの結果に基づいて作成した温度 - ずり速度相図をFigure 3(a)に示す。 Figure 3(b)には観測された SALS の2次元 パターンも示した。高分子の球晶や多重膜 ベシクルのように,球面に垂直な方向と平 行な方向の分極率が異なる球状粒子の SALS 強度の理論は確立されており,これに 基づいて計算した理論パターンをFigure 3c に示す。下のパターンは孤立球,上のパ ターンは最密充填した球に対応する。高温 側で観測されたパターンはこれらの理論パ ターンに類似していることがわかる。以上 の結果は,温度上昇に伴いラメラ→オニオン転移が起こることを示している。

 $C_n E_n \propto on set for the construction of t$

しかし我々が C₁₆E₇ 系で見出したラメラ→ オニオン転移は,温度上昇により起こるた め,このような孤立膜の性質では説明でき ない。すなわちオニオン相の形成条件とし てこれまで考慮されていない因子があり, それを明らかにすることが必要となる。

4. ずり流動場下の温度変化に伴うリエントラ ント(ラメラ→オニオン→ラメラ)転移⁶

 $C_{10}E_{3}$ 系の温度-ずり速度相図が示すオニ オン相の上限温度は、静止状態のラメラ相 の上限温度に近い。一方、 $C_{16}E_{7}$ 系のラメラ 相は、静止状態においてある温度を超える とその下限濃度が大きく低下する(膨潤す る)が¹²⁰、オニオン相の下限温度はラメラ 相の膨潤が起こる温度の下限に近い。これ らのことから、広い温度領域に渡ってラメ ラ相を形成する系であれば、ずり流動場下 において高温側で温度下降に伴うラメラ→ オニオン転移が、低温側で温度上昇に伴う ラメラ→オニオン転移が観測できるのでは ないかと著者らは考えた。そこで、これま で報告されている幾つかの $C_{n}E_m/$ 水系の静 止状態の相図を比較検討した結果, $C_{14}E_{5}/$ 水系が候補になり得ると推定した。この系 の相図は報告されていなかったので,まず 静止状態における相図を作成した。Figure 4(a)に作成した相図を示す。図の黄色い領 域がラメラ相(L_{α} 相)で,15℃~75℃の広 い温度範囲に渡っていることがわかる。



Figure 4. Temperature-concentration diagram for C₁₄E₅ /water system at rest (a) and at a constant shear rate of 3 s⁻¹ (b). L₁, L_{α}, and S indicate micellar, lamellar, and solid (gel) phase, respectively. 2 ϕ indicate two-phase coexistence⁶).

次に、 $C_{14}E_5$ 50 wt%の試料について、一定 ずり速度下で温度を上昇させて(Figure 4(a)の緑の線に対応)rheo-SAXS 測定を行 った。結果を Figure 5 に示す。低温側と高 温側ではずり応力が低く、ほとんどのラメ ラ膜は速度勾配方向に積層しているのに対 して、中間の温度領域ではずり応力が 1~ 2桁高くなり、膜の積層方向が等方的にな ることがわかる。これらの結果は温度上昇 に伴いラメラ→オニオン→ラメラとリエン トラント転移が起こることを示している。 同様の測定を異なる濃度で行い、一定ずり 速度 3 s⁻¹下における動的相図(温度 - 濃度 相図)を作成した(Figure 4(b))。この相 図から,界面活性剤濃度が高くなるとオニ オン相は形成されないこと,オニオン相の 温度領域は界面活性剤濃度の増大と共に縮 小することがわかる。



Figure 5. Temperature dependences of 2-D SAXS patterns for radial (a) and tangential (b) configurations, diffraction intensities for velocity gradient, neutral, and flow directions (b), and shear stress (c) at a shear rate of 3 s⁻¹ for $C_{14}E_5$ (48 wt%) /water system ⁶).

我々はまた、 $C_{14}E_{5}$ 50 wt%の試料について 温度-ずり速度相図も作成した¹⁷⁾。その結 果,オニオン相の温度領域は、ずり速度の 減少と共に縮小することがわかり、さらに $C_{10}E_{3}$ 系の温度-ずり速度相図は $C_{14}E_{5}$ 系の相 図の高温側に、また $C_{16}E_{7}$ 系の相図(Figure 3(a))は $C_{14}E_{5}$ 系の相図の低温側に類似して いることがわかった。 $C_{10}E_{3}$ 系の転移温度は 40℃付近に、 $C_{16}E_{7}$ 系の転移温度は 70℃付近 にあることを考慮すると、一般にラメラ相 からオニオン相に転移する温度領域には上 限と下限が存在し、 $C_{10}E_{3}$ 系では上限のみが、 $C_{16}E_{7}$ 系では下限のみが通常観測可能な温度 範囲内($0 \sim 80^{\circ}C$)にあると考えられる。 $C_{14}E_{5}$ 系が示すような温度変化に対するリエント ラント転移がこれまで報告されていなかっ たのは、このためである。したがって、オ ニオン相の形成条件や転移機構を調べる上 で、 $C_{14}E_{5}$ 系はより一般性を有する系と言え る。

我々は、オニオン相の温度範囲の上限を 上部転移温度、下限を下部転移温度と名付 けた。これは2液相に分離する溶液系にお ける相分離温度の呼び方に倣ったものであ るが、もちろんここでは相分離が起こって いるわけではなく、熱力学的な相としては L_aの単独相のみである。

5. オニオン相の形成条件 6)

ラメラ相からオニオン相への転移は静 止状態では通常起こらないので、オニオン 相の自由エネルギーはラメラ相に比べて高 いことになる。しかし、一定ずり速度下に おいてオニオン相が形成される温度領域に 上限と下限が存在するという我々の実験結 果は、一定ずり速度下の「自由エネルギー」 が定義できるとすれば、ある温度範囲でオ ニオン相の「自由エネルギー」がラメラ相 より低くなることを示唆している。

オニオン相の内部は多重膜ベシクルの みで充填されているので、個々のベシクル は球形ではなく多面体と考えられ(Figure 1)、実際それを支持する電子顕微鏡画像も $1 \sim 2$ 例報告されている。したがって、平 坦なラメラ構造を基準とした場合の弾性エ ネルギーは、多面体の辺と頂点に蓄積され る。辺部分のエネルギー F_{edge} については、 スメクチック液晶の wall の取り扱いに倣い、 次式で表される曲率半径 r_w の曲面と見なし て表式を導いた。

$$r_w \approx \frac{\lambda}{\theta_{\infty}^2}$$
 (5a) $\lambda \equiv \sqrt{\frac{K}{B}}$ (5b)

ただし、2 θ_{o} は辺を挟む2つの面の角度、K はラメラ膜(多層膜)の曲げ弾性率で、式 (1)の κ とラメラ繰返し距離 d を用いて $K = \kappa/d$ と表される。 \overline{B} はラメラ膜の圧縮弾性 率である。最終的に、 F_{edge} は次式で表され る。

 $F_{edge} \propto R^2 \sigma_{eff} \theta_{\infty}^{3} \tag{6}$

ここで、Rはオニオンの半径、 σ_{eff} は次式で 定義される実効的表面張力と呼ばれる量で ある。

$$\sigma_{eff} \equiv \sqrt{KB} \tag{7}$$

一方, 頂点部分の弾性エネルギーF_{vertex}については, 半径 r_wの球の一部と仮定すると, 次式で表される。

 $F_{vertex} \propto (2K + \overline{K})R\theta_{\infty}^{2}$ (8) ただし、 \bar{K} はラメラ膜のサドルスプレイ弾性 率で,式(1)の $\bar{\kappa}$ を用いて $\bar{K} = \bar{\kappa} / d$ と表され る。電荷を持たない膜の場合, \overline{B} や σ_{eff} は ラメラ繰返し距離 d と膜厚δに支配される。 したがって、式(6)(8)から F_{edge} と F_{vertex} はい ずれもdとRに依存することがわかる。そ こで一定ずり速度(3 s⁻¹)下で rheo-SALS 測定を行った結果,転移温度近傍を除いて R はほとんど温度に依存しないことがわか った。一方 Figure 6(a)に示すように, d は 30 ℃ 以上で急速に増大し, 40 ℃ を過ぎ るとほぼ一定になることがわかった。dの 増大は、 $\sigma_{\rm eff}$ を減少させるので、 $F_{\rm edge}$ が減少 することになる。したがって、30 ℃~40 ℃ で温度上昇に伴いラメラからオニオンに転 移するのは、Fedgeの減少によるものと推察 される。一方,式(8)からわかるように Fvertex は、二分子膜のサドルスプレイ弾性率 底 支配されるので、d が温度に依存しない領 域でも温度上昇と共に増加する。したがっ て Figure 6(b)に模式的に示したように, 全弾性エネルギー F_{total} はある温度(T)で 極小値を取ることが予測される。F_{total} は平

板ラメラ構造の弾性エネルギー F_{lam} とのエ ネルギー差であるので、 F_{total} が正であるこ とは、静止状態でオニオンが形成されない ことに対応している。しかし、ずり流動場 下における平板ラメラ構造の弾性エネルギ ー F_{lam} は静止状態のエネルギー F_{lam} より 大きい可能性があり、ずり速度一定下で温 度を変化させた場合には、Figure 6(b)のよ うに $F_{total} < F_{lam}^{shear}$ となる温度領域が出現す る可能性がある。この温度領域がオニオン 相になると考えられる。



Figure 6. (a) Temperature dependence of the lamellar repeat distance at rest at 48 wt% (\bigcirc), 50 wt% (\triangle), 55 wt% (\square), and 57 wt% (\diamondsuit) of C₁₄E₅ in water. (b) Schematic Temperature dependence of the deformation energy of the polyhedral onions⁶⁾.

Figure 6(a) からわかるように,界面活性 剤濃度が上昇すると,dが減少するので F_{total} が増大し, $F_{total} < F_{tam}^{shear}$ となる温度領域が狭 くなる。この予測は Figure 4(b)の動的相 図と一致する。Figure 6(a)はまた,温度上 昇に伴うdの上昇が頭打ちになる温度は, 濃度にあまり依存しないことを示している。 このことは, *T*は濃度にあまり依存しない ことを示しており, Figure 6(b)から推測され るように, 濃度増大により下部転移温度よ りも上部転移温度がより大きく変化するこ とを示唆している。これは実測の温度-濃度 相図(Figure 4b)と良く一致している。

一方, ずり速度を上昇させると F_{lam} はさらに増大すると考えられるので,オニオン相の温度範囲は広がる。Figure 6(b)は, ずり速度上昇により,下部転移温度よりも上部転移温度がより大きく変化することを示しており,このことは実測の温度-ずり速度相図と良く一致する。

このような考え方が正しければ,オニオ ン形成は,平衡状態では僅かにエネルギー が高いために埋もれていた性質が,ずり流 動場により露わになった現象として解釈す ることができる。

6. ラメラ/オニオン転移機構

オニオン相を発見した Roux のグループは、 試料を挟んでいる板の表面の凹凸がラメラ 相の欠陥を生じさせ、この欠陥がずり流動 場に追随できなくなるためにオニオン相に 転移すると考えた¹⁾。しかしこのモデルに 基づいて計算された転移に必要な最低ずり 速度は $10^{-4} - 10^{-3} \text{ s}^{-1}$ となり¹³⁾, 一般的な 実測値(0.1 - 10 s⁻¹)より 1~5 桁低くな る。

これに対して, Zilman と Granek¹⁴⁾は, ラ メラ膜の nm スケールの波打ち運動

(undulation) とずり流動場のカップリン グにより、膜が neutral 方向に伸びようと する力が生じ、これが空間的に妨げられる ために、多数の膜が μ m スケールで波打つ 「coherent buckling」が起こり、オニオン に移行するというモデルを提案した。しか しこのモデルに基づく転移ずり速度は、典 型的な実験条件に対して 3 × 10³ s⁻¹ と見 積もられ, 一般的な実測値よりも 2~4 桁高 くなる。

Richtering のグループは、 $C_{10}E_3/$ 水系の ラメラ相に、温度一定下(室温)で一定ず り速度の流動場を印加した後の構造変化を 時分割中性子小角散乱により追跡し、オニ オン相に転移する途中で neutral 方向の強 度が極大を示すことを見出した¹⁵⁾¹⁶⁾。彼ら はこの結果を、過渡的な中間構造として多 層膜の円筒(リーク)または coherent buckling が形成されるためと解釈してい る¹⁶⁾。

我々は、C₁₆E₇/水系の転移温度(下部転移 温度に相当)近傍において、詳細な rheo-SAXS 測定を行った⁵⁾。また C₁₄E₅/水系 では、上部および下部転移温度の近傍にお いて、昇温・降温両過程で rheo-SAXS 測定 を行った⁶⁾。C₁₄E₅/水系の下部転移温度近 傍における結果を Figure 7 に示す。昇温過 程 (ラメラ→オニオン転移)の回折強度(b) を見ると、低温側ではほとんどのラメラ膜 が速度勾配方向に配向していることがわか る。温度上昇と共にその傾向はさらに強ま り, ずり応力が上昇し始める直前に極大を 示し,その後急激に減少する。速度勾配方 向の強度極大の後, neutral 方向の強度が 増大して極大をとる。これより前に行った C16E7系でも同様の結果が得られているので、 このような膜の配向変化は普遍性があると 考えられる。

これらの結果を Zilman-Granek のモデ ルと比較すると,速度勾配方向の強度のさ らなる増大は buckling の前兆とも解釈で きる。しかし, buckling は不可逆過程と考 えられるので,もしその前兆であれば,温 度一定下で測定を続けた場合,強度は減少 していくはずである。そこで,速度勾配方 向の強度が極大を取る温度に1時間保持し て rheo-SAXS 測定を行ったが,強度変化は 見られなかった⁶。前後の温度でも同様の 実験を行ったが、Figure 7(a)(b)に中抜き 記号で示すように、同じずり応力値と回折 強度が再現された。またFigure 7(c)、(d) に示すように、降温過程(オニオン→ラメ ラ転移)においても昇温過程と同様の温度 依存性が観測された。上部転移温度近傍で はかなり大きなヒステリシスが見られたが、 各方向の回折ピーク強度の変化の順序は同 じであることがわかった。





以上の実験結果は、中間領域における膜 の配向は、一定ずり速度の下では温度のみ に依存することを示唆している。Figure 8 に膜の配向変化を模式的に示した。図中の ラメラ膜の線の太さは、太いほどその方向 に配向した膜が多いことを示している。



Figure 8. Change in orientation of lamellae with varying temperature both for the lower and upper transition temperature in the lamellar phase of $C_{14}E_5$ /water system.

ここまでは、ずり速度一定下の温度変化 に伴う転移過程について述べてきたが、 我々はまた、温度一定下でずり速度を変化 させた rheo-SAXS 測定も行っており、C₁₆E₇/ 水系⁵⁾、C₁₄E₅/水系¹⁸⁾共に、ずり速度を上昇 させた場合もラメラ→オニオン転移過程に おいて、Figure 8と同様の膜の配向変化を 示す実験結果を得ている。このことは、ラ メラとオニオンの間の中間構造が、温度と ずり速度で決まる定常状態として存在する ことを示唆している。

先に述べたように、ラメラからオニオン に 転 移 す る ず り 速 度 範 囲 で は shear-thickening が観測されることが知 られている。我々が $C_{16}E_{7}$ 系と $C_{14}E_{5}$ 系で行っ た実験でも、測定時間が短い場合は同様の 結果が得られたが、測定時間を十分にとる と、shear-thickening のように見えたずり 速度領域に、shear thickening を示すずり 速度領域が二つ存在し、その間に shear-thinning領域が存在することが、 $C_{14}E_5$ 系においてわかった¹⁸⁾。この shearthinning領域では、回折強度の関係が速度 勾配方向 \approx neutral 方向 >> flow 方向とな った¹⁸⁾。これらの結果は、棒状の多重膜ベ シクルが過渡的ではなく定常的な中間状態 として存在することを示唆している。

ラメラ-オニオン-ラメラ転移の要因が, 5 節で述べたように弾性エネルギーの温度 依存性にあるならば,中間状態に対しても 同様の議論が成り立つと考えられる。オニ オンが多面体であることを考えると,棒状 ベシクルについても多角柱の両端に多面体 の半分が付いたような構造が考えられる。 その場合は,多面体オニオンと同様に全弾 性エネルギーは Fedge と Fvertex で記述できる が,多面体オニオンに比べると Fedgeの寄与 がより大きくなる。多面体オニオンに限っ ても,式(6)(8)は実測可能な d と R 以外に幾 つかの未知量を含むので,今後これらの定 量的な見積もりが必要になる。

7. おわりに

以上,界面活性剤のずり流動場誘起ラメ ラ/オニオン転移について,我々がこの10 年間で明らかにしてきたことを中心に述べ た。オニオン相の形成条件と転移機構に関 する他グループの研究で,ここで述べてい ないものについては,総説³⁾¹⁹⁾を執筆して いるので参照いただきたい。

我々が温度変化に伴うリエントラント 転移を見出したことにより,オニオン相の 形成条件についての理解が飛躍的に深まっ たと考えている。転移機構については,ラ メラとオニオンの間の中間状態は過渡的な ものではなく,温度とずり速度で決まる定 常状態であることがわかったが,なぜその 条件で中間状態が安定になるかという点は 依然として不明である。現在 SAXS 回折強度 の方位角依存性と光学顕微鏡観察による中 間状態のより詳細な構造解析と,理論的な 考察を進めている。

謝辞

本研究の共同研究者である川端庸平助教, 小阪有里子,伊藤真紀子,佐藤大治郎,釘 崎 栞の各修士に改めてお礼申し上げる。本 研究は,科学研究費補助金(特定領域研究: 課題番号18068016,基盤研究B:課題番号 23340124)からの補助を受けて行った。 rheo-SAXSの測定は,高エネルギー加速器 研究機構放射光科学研究施設の BL-15A と BL6A(課題番号2011G589)およびSpring-8 の BL40B2(課題番号2011G589-2011A1921) において行った。

参考文献

- 1) Diat, O.; Roux, D.; Nallet, F. J. Phys. II Fr., **1993**, *3*, 1427–1452.
- 2) Richtering, W. *Curr. Opin. Colloid Interface Sci.*, **2001**, *6*, 446–450.
- Kato, T. Shear-Induced Lamellar/Onion Transition in Surfactant Systems. In Advances in Biomembranes and Lipid Self-Assembly; 2018; Vol. 27, pp 187– 222.
- 4) Kosaka, Y.; Ito, M.; Kawabata, Y.; Kato, T. *Langmuir*, **2010**, *26*, 3835–3842.
- 5) Ito, M.; Kosaka, Y.; Kawabata, Y.; Kato, T. *Langmuir*, **2011**, *27*, 7400–7409.
- Sato, D.; Obara, K.; Kawabata, Y.; Iwahashi, M.; Kato, T. *Langmuir*, 2013, 29, 121–132.
- 7) Safran, S. A. Adv. Phys., **1999**, 48, 395–448.
- 8) Helfrich, W. J. Phys. Condens. Matter, **1994**, 6, A79–A92.
- Porte, G.; Appell, J.; Bassereau, P.; Marignan, J. J. Phys. Fr., **1989**, 50, 1335– 1347.
- 10) Oliviero, C.; Coppola, L.; Gianferri, R.; Nicotera, I.; Olsson, U. *Colloids Surfaces A Physicochem. Eng. Asp.*, **2003**, 228, 85–90.
- Le, T. D.; Olsson, U.; Mortensen, K.; Zipfel, J.; Richtering, W. *Langmuir*, 2001, *17*, 999–1008.
- 12) Minewaki, K.; Kato, T.; Yoshida, H.; Imai, M.; Ito, K. *Langmuir*, **2001**, *17*,

1864–1871.

- Wunenburger, A. S.; Colin, A.; Colin, T.; Roux, D. Eur. Phys. J. e, 2000, 2, 277– 283.
- 14) Zilman, a. G.; Granek, R. *Eur. Phys. J. B*, **1999**, *11*, 593–608.
- 15) Zipfel, J.; Nettesheim, F.; Lindner, P.; Le, T. D.; Olsson, U.; Richtering, W. *Europhys. Lett.*, 2001, *53*, 335–341.
- 16) Nettesheim, F.; Zipfel, J.; Olsson, U.; Renth, F.; Lindner, P.; Richtering, W. *Langmuir*, **2003**, No. 7, 3603–3618.
- 釘崎 栞,川端 庸平,加藤 直,第66回コ ロイドおよび界面化学討論会(2015.9,鹿 児島).
- 18) 鈴木健斗,川端庸平,菜嶋健司,大野宏 策,加藤直,日本化学会第98春季年会 (2018.3,船橋).
- 19) 加藤 直, 表面、49, 407-422 (2011).